

2009年4月17日

平成21年度「知財功労賞表彰式」、経済産業大臣表彰を受賞

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：大林 秀仁／以下、日立ハイテク）は、本日霞山会館（霞が関コモンゲート）（東京都千代田区）で開催された平成21年度「知財功労賞表彰式」において「経済産業大臣表彰（特許戦略優良企業）」を受賞しました。

本賞は、産業財産権制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献のあった企業に対して贈られるもので、電子デバイスやライフサイエンス分野での最先端製品のグローバル展開と世界トップシェアの維持、経営陣・社員における知的財産意識の浸透、知的財産戦略の明確化、表彰・報奨制度の充実など、当社の知的財産戦略を評価いただき、今回の受賞に至りました。

日立ハイテクは、フラッグシップ特許活動をはじめとする知的財産活動を日立製作所知的財産権本部および日立製作所の各研究所と連携しながら推進しています。

日立ハイテクは、知的財産権を経営における重要な資産として位置付けており、積極的な活用と価値の向上に取り組んでいます。今後も知的財産活動のより一層の推進を図り、企業価値の向上に努めていきます。



受賞者の記念撮影



表彰状を授与される大林 執行役社長

<ご参考>

プレスリリース：特許戦略優良企業として経済産業大臣表彰を受賞（2009年4月7日）

【「知財功労賞」について】

特許庁では、昭和62年より、毎年4月18日の「発明の日」に産業財産権制度の普及促進及び発展に貢献のあった個人及び企業に対し「知財功労賞」の表彰を行っています。

「知財功労賞」は、「産業財産権制度関係功労者表彰」及び「産業財産権制度活用優良企業等表

彰」を総称したもので、産業財産権制度の普及促進と適正な実施に貢献のあったものを適切に表彰し、これを公表することにより、産業財産権制度関係者の士気の高揚を図り、国民の一層の理解と協力を得、もって産業財産権行政の円滑な遂行を図ることを目的としています。

お問い合わせ先

社長室 広報・IRグループ 担当：塩澤

TEL：03-3504-5637